

Oferta nr. 14/14

Tytuł

Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni w procesie elektrochemicznym, powierzchnia otrzymana tym sposobem i jej zastosowanie

Pełne Streszczenie

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania powierzchni pokrytej nanocząstkami metalu, platforma otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS). Innowacyjność metody polega na połączeniu prostej techniki elektrochemicznej z nowym sposobem przygotowania roztworu elektrolitu, którego kluczowym warunkiem jest kontrola ustalonej temperatury roztworu. Uzyskana powierzchnia charakteryzuje się jednorodnym rozkładem nanocząstek o rozmiarach 50 \square 400 nm. Platformy te dają możliwość detekcji substancji chemicznych zaadsorbowanych z ich bardzo rozcieńczonych roztworów, a przy tym wykazują powtarzalność sygnałów na widmach SERS.

Twórcy

Monika Księżopolska-Gocalska, Weronika Michałowicz, Marta Siek, Joanna Niedziółka-Jönsson, Marcin Opałło, Robert Hołyst

Dziedzina

- Chemia - Chemia materiałów podstawowych
- Chemia - Technologia powierzchni, powłoki
- Chemia - Mikro- i nanotechnologia

Zalety / innowacyjne aspekty

- Nowy, łatwy i szybki sposób przygotowywania roztworu elektrolitu.
- Niski koszt wytwarzanych podłoży.
- Wysoki współczynnik wzmocnienia (EF) dla podłoży daje możliwość detekcji związków z ich bardzo rozcieńczonych roztworów.
- Uzyskanie powtarzalności sygnałów na widmach SERS na powierzchni pojedynczej platformy a także w całej ich serii.
- Jednorodny rozkład nanocząstek metalu na powierzchni.

Słowa kluczowe

platforma SERS, Raman, nanocząstki, elektrochemia, temperatura roztworu, powtarzalność

Zastosowanie

Projektowanie i prototypowanie, Czyszczenie i przygotowanie powierzchni, Kontrolowanie procesów, Inżynieria procesowa, Materiały elektryczne, Chemia analityczna, Mikro. i Nano.technologie, Czujniki pomiarowe, Pomiary zanieczyszczeń, Zanieczyszczenia wody, ścieki

Stan zaawansowania

etap gotowości do wdrożenia

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszenie patentowe w Polsce

ICHF dla Firm ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

TEL: 22 343 33 12 | FAX: 22 343 33 33

ichfdlafirm@ichf.edu.pl | NIP: 525-000-87-55